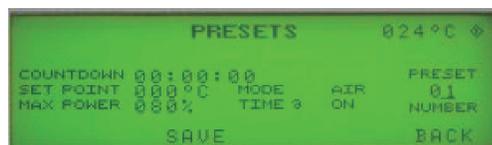


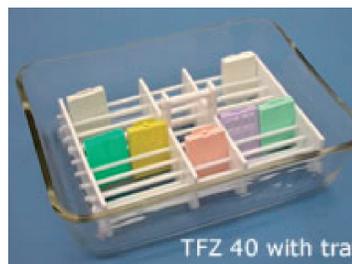
H2850

真空マイクロウェーブプロセッサ

次世代マイクロウェーブプロセッサ



処理条件設定用ディスプレイ



H2835 TFZ カセットホルダー 40 または 64 カセット用 (オプション)



ポーラーヒート
真空プロセス対応
パラフィン加熱シート

マイクロウェーブ組織処理のパイオニアである米国 EB サイエンス社から、多くのユーザー・フィードバックを受け、次世代マイクロウェーブプロセッサが販売されました。

長年の開発により、先例のない柔軟性、機能性、± 0.5 度の温度制御、各種安全装置、真空排気及び空気導入が可能な多目的真空 / 流体ポート搭載等のニーズにお応えしています。

主な特徴

- 40 通りのプログラム処理をあらかじめ登録可能。
- 操作ボタンは非常にシンプルになっています。
- 高性能なチャンバーベントシステムを搭載。
- ささまざまな各種安全装置を搭載。
- 毎秒毎に温度コントロールが可能。
- 本体及び内装などクリーンなステンレス製。
- 外部拡張ポート (流体・真空・ガス) を搭載。

オプション



H2512 マイクロウェーブ
10 ディスポーザルトレイ付ラック



H2513 蓋付スライド着色皿
1つのホルダー用の緑のコンテナ



H2817 マルチプルエアーかくはん器
4 かくはんポート付



H2518 スライド着色ホルダー

その他オプションにつきましては別途お問い合わせください。

本体仕様

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 電 源 | 単相 100V |
| 最大出力 | 1000W |
| 寸 法 | 555mm (幅) / 635mm (奥行) / 508mm (高さ) |
| 室内サイズ | 355mm (幅) / 406mm (奥行) / 228mm (高さ) |
| 重 量 | 34Kg |